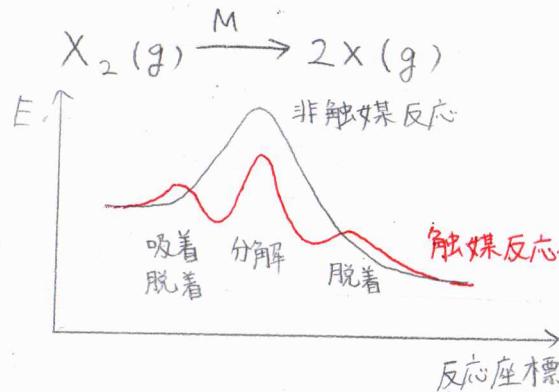


不均一系触媒作用

★ 1分子反応



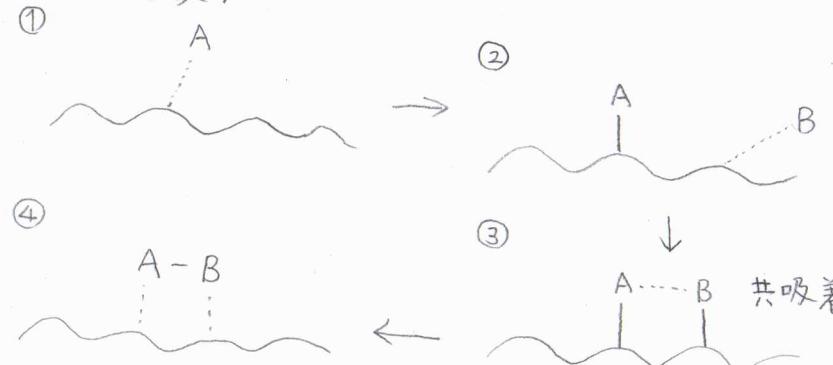
分解の素反応が律速段階となる。

$$\text{分解速度 } v = k_r \theta$$

θ がランゲミュアの等温式で与えられるとき。

$$v = \frac{k_r \alpha p}{1 + \alpha p}$$

★ 2分子反応



第2の吸着質は、触媒表面の電子構造変化の影響を受ける可能性がある。(②の状態)
触媒のはたらきを増強する物質を助触媒、阻害する物質を触媒毒という。

ランゲミュア-ヒンシェルウッド (LH) 機構



$$P\text{の生成速度 } v = k_r \theta_A \theta_B$$

θ_A と θ_B がどちらもランゲミュアの等温式で書けるとき。

$$A\text{の吸着速度: } k_{a,A} p_A N_{\text{sites}} (1 - \theta_A - \theta_B)$$

$$A\text{の脱着速度: } k_{d,A} N_{\text{sites}} \theta_A$$

$$B\text{の吸着速度: } k_{a,B} p_B N_{\text{sites}} (1 - \theta_A - \theta_B)$$

$$B\text{の脱着速度: } k_{d,B} N_{\text{sites}} \theta_B$$

平衡状態では、

$$\begin{cases} k_{a,A} p_A N_{\text{sites}} (1 - \theta_A - \theta_B) = k_{d,A} N_{\text{sites}} \theta_A \\ k_{a,B} p_B N_{\text{sites}} (1 - \theta_A - \theta_B) = k_{d,B} N_{\text{sites}} \theta_B \end{cases}$$

$$\alpha_A = k_{a,A} / k_{d,A}, \quad \alpha_B = k_{a,B} / k_{d,B} \text{ とする。}$$

$$\begin{cases} \alpha_A p_A (1 - \theta_A - \theta_B) = \theta_A \\ \alpha_B p_B (1 - \theta_A - \theta_B) = \theta_B \end{cases}$$

これを解くと、

$$\theta_A = \frac{\alpha_A p_A}{1 + \alpha_A p_A + \alpha_B p_B}$$

$$\theta_B = \frac{\alpha_B p_B}{1 + \alpha_A p_A + \alpha_B p_B}$$

したがって

$$\begin{aligned} v &= k_r \theta_A \theta_B \\ &= \frac{k_r \alpha_A \alpha_B p_A p_B}{(1 + \alpha_A p_A + \alpha_B p_B)^2} \end{aligned}$$

○イ-レイ-リティール(ER)機構



$$v = k_r p_B \theta_A$$

θ_A がラングミュアの等温式で与えられるとき、

$$v = \frac{k_r \alpha p_A p_B}{1 + \alpha p_A}$$

$\alpha p_A \gg 1$ のとき、 $v \approx k_r p_B$

Bが基質表面のAと衝突して起こる素反応が律速

$\alpha p_A \ll 1$ のとき、 $v \approx k_r \alpha p_A p_B$

被覆率が反応速度に大きく影響する。

LH機構とER機構は、理想的な極限であり。

実際の反応機構は、両者の間に位置する。